PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-158043

(43)Date of publication of application: 30.05.2003

(51)Int.Cl.

H01G 9/028 C08G 61/12 C08G 73/00

(21)Application number: 2001-346853

(71)Applicant: TAYCA CORP

(22)Date of filing:

13.11.2001

(72)Inventor: TOZAWA MASAAKI

SUGIHARA RYOSUKE

TSUZUKI TAKAO

(30)Priority

Priority number : 2001272842

Priority date: 10.09.2001

Priority country: JP

(54) CONDUCTIVE POLYMER AND SOLID ELECTROLYTIC CAPACITOR USING THE SAME

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a conductive polymer with excellent conductivity and heat resistance, and to provide a solid electrolytic capacitor highly reliable under high-temperature and high-humidity conditions by using this conductive polymer as a solid electrolyte.

SOLUTION: There is provided a conductive polymer by adding as a dopant at least one or more sulfonic acids selected from tetrahydronaphthalenesulfonic acid containing one or more sulfone groups or alkyltetrahydronaphthalenesulfonic acid containing one or more alkyl groups having 1–18 carbon atoms and one or more sulfone groups. As a monomer for synthesizing the conductive polymer, at least one or more selected from pyrrole, thiophene, and aniline and derivatives thereof are preferable. A solid electrolytic capacitor is provided by using this conductive polymer as a solid electrolyte.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-158043 (P2003-158043A)

(43)公開日 平成15年5月30日(2003.5.30)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコート*(参考)
H01G 9/028		C 0 8 G 61/12	4 J 0 3 2
C 0 8 G 61/12		73/00	4 J 0 4 3
73/00		H01G 9/02	331E

審査請求 未請求 請求項の数3 〇1. (全8 頁)

		帝旦明礼	不開水 開水県の数3 OL (宝 8 貝)
(21)出願番号	特願2001-346853(P2001-346853)	(71)出願人	000215800
			テイカ株式会社
(22)出顧日	平成13年11月13日(2001.11.13)		大阪府大阪市大正区船町1丁目3番47号
		(72)発明者	戸澤 正明
(31)優先権主張番号	特願2001-272842 (P2001-272842)		大阪市大正区船町1丁目3番47号 テイカ
(32)優先日	平成13年9月10日(2001.9.10)		株式会社内
(33)優先權主張国	日本 (JP)	(72)発明者	杉原 良介
			大阪市大正区船町1丁目3番47号 テイカ
			株式会社内
		(74)代理人	100078064
		(14) (44)	弁理士 三輪 鐵雄
	2		万生上 二十 以
			63

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 導電性高分子およびそれを用いた固体電解コンデンサ

(57)【要約】

【課題】 導電性が優れ、しかも耐熱性が優れた導電性 高分子を提供し、かつ、その導電性高分子を固体電解質 として用いて高温・高温条件下における信頼性の高い固 体電解コンデンサを提供する。

【解決手段】 一つ以上のスルホン基を含有するテトラヒドロナフタレンスルホン酸、または炭素数が1~18のアルキル基を一つ以上含有し、かつ一つ以上のスルホン基を含有するアルキルテトラヒドロナフタレンスルホン酸から選ばれる、少なくとも一つ以上のスルホン酸をドーパントとして含有させて導電性高分子を構成する。上記導電性高分子の合成用モノマーとしては、ピロール、チオフェン、アニリンおよびそれらの誘導体から選ばれる少なくとも一つ以上が好ましい。そして、上記導電性高分子を固体電解質として用いて固体電解コンデンサを構成する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一つ以上のスルホン基を含有するテトラ ヒドロナフタレンスルホン酸、または炭素数が1~18 のアルキル基を一つ以上含有し、かつ一つ以上のスルホ ン基を含有するアルキルテトラヒドロナフタレンスルホ ン酸から選ばれる、少なくとも一つ以上のスルホン酸を ドーパントとして含む導電性高分子。

【請求項2】 導電性高分子合成用のモノマーが、ピロ ール、チオフェン、アニリンおよびそれらの誘導体から 選ばれる少なくとも一つ以上である請求項1記載の導電 10 性高分子。

【請求項3】 請求項1または2記載の導電性高分子を 固体電解質として用いたことを特徴とする固体電解コン デンサ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、導電性高分子およ びその導電性高分子を固体電解質として用いた固体電解 コンデンサに関する。

[0002]

【従来の技術】導電性高分子は、その高い導電性によ り、アルミニウムコンデンサ、タンタルコンデンサなど の固体電解コンデンサの固体電解質などに用いられてい る。

【0003】そのような用途における導電性高分子とし ては、ピロール、チオフェン、アニリンまたはそれらの 誘導体を化学酸化重合または電解酸化重合することによ って合成したものが用いられている。

【0004】酸化重合を行う際のドーパントには、主に 有機スルホン酸が用いられ、それらの中でも特に芳香族 スルホン酸が多用されている。

【0005】しかしながら、芳香族スルホン酸の出発材 料であるアルキルベンゼンのアルキル鎖は、長鎖の場 合、混合アルキルであって単一化合物として一定してい ないので、得られる導電性高分子の導電性がばらつく原 因となる。例えば、ドデシルベンゼンスルホン酸(分子 量326)のように単一分子量であっても、構造異性体 の存在が電気特性に影響する。また、長鎖アルキル基を 有する長鎖型芳香族スルホン酸は、分子サイズが大きい ため、ドーピングしづらく、結果として初期重合段階で は充分な導電性が得られない。

【0006】一方、短鎖型芳香族スルホン酸、例えばべ ンゼンスルホン酸(分子量158)やトルエンスルホン 酸(分子量172)は、分子サイズが小さく、ドーピン グレやすいので初期重合段階では良好な導電性が得られ るものの、その小さい分子サイズのため、脱ドーピング が起こりやすく、特に高温・高湿条件下で放置した場合 には、顕著な導電性の低下が認められる。

【0007】上記のような状況から、初期重合段階で良 好な導電性が得られ、しかも高温・高湿条件下で放置し 50 ても大きな導電性の低下が認められず、導電性のばらつ きが少ない導電性高分子を構成することができるドーパ ントが求められている。

【0008】そこで、上記のような要求に応えるべく、 導電性高分子用ドーパントとして、特公平6-8259 0号公報にナフタレンスルホン酸を用いることが提案さ れている。しかしながら、上記ナフタレンスルホン酸を ドーパントとする高分子は、導電性および耐熱性の点に おいて充分に満足できるものとはいえなかった。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記のよう な従来技術の問題点を解決し、導電性が優れ、しかも耐 熱性が優れた導電性高分子を提供し、かつ、それを固体 電解質として用いて高温・高湿条件下での信頼性の高い 固体電解コンデンサを提供することを目的とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記課題 を解決するため鋭意研究を重ねた結果、一つ以上のスル ホン酸を含有するテトラヒドロナフタレンスルホン酸、 20 または炭素数1~18のアルキル基を一つ以上含有し、 かつ一つ以上のスルホン基を含有するアルキルテトラヒ ドロナフタレンスルホン酸をドーパントとして含む導電 性高分子が、上記課題を解決できる特徴を有しているこ とを見出した。

[0011]

【発明の実施の形態】上記一つ以上のスルホン酸を含有 するテトラヒドロナフタレンスルホン酸や炭素数1~1 8のアルキル基を一つ以上含有し、かつ一つ以上のスル ホン酸を含有するアルキルテトラヒドロナフタレンスル ホン酸の具体例としては、例えば、テトラヒドロナフタ レンモノスルホン酸、テトラヒドロナフタレンジスルホ ン酸、ジイソプロピルテトラヒドロナフタレンモノスル ホン酸、モノブチルテトラヒドロナフタレンジスルホン 酸、ジノニルテトラヒドロナフタレンモノスルホン酸な どが挙げられるが、スルホン酸部分に関して、モノ体で あるか、ジ体であるか、トリ体であるかは、それほどこ だわる必要はなく、テトラヒドロナフタレンスルホン酸 またはアルキルテトラヒドロナフタレンスルホン酸の範 疇に入っているものであればよく、例えば実施例で用い るようなモノスルホン酸を主体とし、ジスルホン酸とト リスルホン酸を少量含むものであってもよい。

【0012】テトラヒドロナフタレン(テトラリン) は、ナフタレンが有する二つの芳香環のうちの一方が完 全に水素化されたシクロアルキル環が、ベンゼン環に付 加した構造を有しており、したがって、単環であるベン ゼンや複員環であるナフタレンとは全く異なった化学的 性質を有している。

【0013】テトラヒドロナフタレンスルホン酸は、上 記テトラヒドロナフタレンを濃硫酸と混合し、スルホン 化した後、苛性ソーダなどのアルカリ剤で中和し、晶析

40

分離などの精製処理をすることによって合成することが できる。

【0014】また、アルキルテトラヒドロナフタレンスルホン酸は、例えば、ブタノールとテトラヒドロナフタレンと濃硫酸や発煙硫酸などを混合し、アルキル化およびスルホン化した後、苛性ソーダなどのアルカリ剤で中和し、晶析分離などの精製処理をすることによって合成することができる。

【0015】本発明において、導電性高分子合成用モノマーとしては、例えば、ピロール、チオフェン、アニリンおよびそれらの誘導体から選ばれる少なくとも1種を用いることができる。

【0016】つぎに、本発明の導電性高分子の合成方法について説明する。

【0017】本発明の導電性高分子の合成にあたっては、まず、ピロール、チオフェン、アニリンおよびそれらの誘導体から選ばれる少なくとも1種の導電性高分子合成用モノマーを、(アルキル)テトラヒドロナフタレンスルホン酸をドーパントとして用いて、化学酸化重合または電解酸化重合を行う。

【0018】化学酸化重合の場合、上記(アルキル)テトラヒドロナフタレンスルホン酸を遷移金属塩、例えば第二鉄塩や第二銅塩とし、それらの金属塩と導電性高分子合成用モノマーとを、有機溶媒で特定濃度となるよう、それぞれ別途あらかじめ希釈しておき、溶液同士を混合して一定時間反応させた後、洗浄、乾燥して導電性高分子を合成することができる(ここで用いているスルホン酸塩は、その遷移金属成分が導電性高分子合成用モノマーの酸化重合剤として働き、残りのスルホン酸成分は高分子マトリックス中に含有され、いわゆるドーパントの役割を果たす)。上記重合に際して用いる有機溶媒としては、例えばメタノール、エタノール、nープロパノール、nーブタノールなどが挙げられ、洗浄の際にも上記溶媒のいずれかを用いればよい。

【0019】電解酸化重合の場合、上記(アルキル)テトラヒドロナフタレンスルホン酸またはその塩(ナトリウム、カリウム塩など)と、導電性高分子合成用モノマーとを、溶媒に溶解しておき、定電位または定電流条件下でモノマーの重合を進めて導電性高分子を合成する。この電解酸化重合に際して用いる溶媒としては、例えば、水、メタノール、エタノール、nープロパノール、nーブタノールなどが挙げられ、洗浄の際にも上記溶媒のいずれかを用いればよい。

【0020】このようにして合成された導電性高分子は、導電性が優れ、しかも耐熱性が優れており、したがって、コンデンサ、バッテリー、帯電防止シート、耐腐食用塗料などの用途において有用である。

[0021]

【実施例】以下に実施例を挙げて本発明をより具体的に 説明する。ただし、本発明はそれらの実施例に例示のも 50 ののみに限定されることはない。また、実施例に先立ち、実施例の導電性高分子のドーパントとなる一つ以上のスルホン酸を含有するテトラヒドロナフタレンスルホン酸や炭素数1~18のアルキル基を含有し、かつ一つ以上のスルホン酸含有するアルキルテトラヒドロナフタレンスルホン酸の合成を合成例1~3として示す。なお、以下において、溶液や分散液などの濃度を示す%は質量基準によるものである。

【0022】合成例1

温度80℃の条件下、攪拌しながら98%硫酸392gをテトラヒドロナフタレン580gに滴下した。上記硫酸の滴下後、反応液の温度を120℃に上げ、その温度を保ちながら4時間攪拌した。反応終了後、300gの蒸留水を加え、2層分離した下層部分のみを取り出し、蒸留による濃縮と水の添加を繰り返して、完全に未反応のテトラヒドロナフタレンを除去することにより、テトラヒドロナフタレンスルホン酸を得た。なお、このようにして得たテトラヒドロナフタレンスルホン酸は、モノスルホン酸が主体で、ジスルホン酸とトリスルホン酸を少量含んでいた。

【0023】合成例2

テトラヒドロナフタレン245gとメタノール110g とを混合した。水冷下、この混合液を攪拌しながら、そ の中に98%硫酸975gをゆっくり添加した。その 後、30分間攪拌した。さらに、28%発煙硫酸124 gをゆっくり添加した後、55℃の条件下、4時間攪拌 を続け反応させた。得られた反応液に、nーブタノール 300gと蒸留水500gを添加した後、2層分離した 上層部分を取り出した。取り出した上層部分にさらにも う一度蒸留水500gを添加し、2層分離した上層を取 り出すことにより、反応液から硫酸分を除去した。得ら れた反応液を蒸留により濃縮し、水を添加する操作をさ らに6回繰り返すことによって、反応液の溶媒をn-ブ タノールから水に置換した。さらに、未反応のテトラヒ ドロナフタレンおよびメチルテトラヒドロナフタレンを 取り除くため、石油エーテル500mlを添加し、充分 に攪拌した後、静置した。2層分離した下層を取り出 し、蒸留により濃縮し、水を添加する操作を繰り返して 非水溶性成分を取り除くことにより、メチルテトラヒド ロナフタレンスルホン酸を得た。なお、このようにして 得たメチルテトラヒドロナフタレンスルホン酸は、モノ スルホン酸が主体で、ジスルホン酸とトリスルホン酸を 少量含んでいた。

【0024】合成例3

メタノールに代えてnーブタノール263gを添加した 以外は、全て合成例2と同様の操作を行い、ブチルテト ラヒドロナフタレンスルホン酸水溶液を得た。そして、 5mol/lの水酸化ナトリウム水溶液で中和すること により、ブチルテトラヒドロナフタレンスルホン酸ナト リウム水溶液を得た。なお、前記のようにして得たブチ

ルテトラヒドロナフタレンスルホン酸は、モノスルホン酸が主体で、ジスルホン酸とトリスルホン酸を少量含んでいた。

【0025】実施例1

まず、上記合成例1で得たテトラヒドロナフタレンスルホン酸を水酸化第二鉄と反応させて、濃度50%のテトラヒドロナフタレンスルホン酸第二鉄塩水溶液を得た。なお、使用した水酸化第二鉄は次に示すように合成した。

【0026】室温の条件下、1000m1の蒸留水に下 e_2 (SO_4)。 $\cdot 8H_2$ Oを108.6g (0.2m o 1) 溶解して調製した溶液を激しく攪拌しながら、その中に5mo1/1 の水酸化ナトリウム水溶液をゆっくりと添加してpH7 に調整した後、遠心分離により上澄みを取り除いて水酸化第二鉄の沈殿を得た。余分の水溶性塩を取り除くため、4000m1 の蒸留水に上記水酸化第二鉄の沈殿を分散させた後、遠心分離で上清を取り除く操作を2回繰り返した。得られた水酸化第二鉄の沈殿を500g のノルマルブタノールに分散させた。

【0027】これとは別に、上記合成例1で得たテトラヒドロナフタレンスルホン酸229gをあらかじめ500gのノルマルブタノールに溶解しておき、その溶液中に上記方法で調製した水酸化第二鉄の分散液を添加した。室温下、12時間かきまぜて反応させた後、蒸留して濃度50%のテトラヒドロナフタレンスルホン酸第二鉄塩のノルマルブタノール液を得た。

【0028】上記テトラヒドロナフタレンスルホン酸第 二鉄塩を濃度が0.5mol/1になるようにn-ブタ ノールを添加して濃度調整した後、その溶液に3、4-エチレンジオキシチオフェンを濃度が0.5mol/1 になるように添加し、充分にかき混ぜ、上記テトラヒド ロナフタレンスルホン酸第二鉄塩を酸化剤として、3, 4-エチレンジオキシチオフェンの化学酸化重合を開始 させ、それを直ちに、3cm×5cmのセラミックプレ ート上に180μ1滴下した。そして、そのセラミック プレート上で湿度55%、温度25℃で12時間重合し た後、エタノール中に上記プレートをその上に形成され た重合物膜と共に入れ、洗浄し、130℃で30分間乾 燥した。乾燥後、上記プレートに1.5 t の荷重をかけ たまま5分間放置して、膜圧を均等にした後、その重合 40 物であるポリエチレンジオキシチオフェンの電導度を4 探針方式の電導度測定器(三菱化学社製のMCP-T6

00) により測定した。その結果を後記の表1に示す。 【0029】実施例2

合成例1で得たテトラヒドロナフタレンスルホン酸に代えて、合成例2で得たメチルテトラヒドロナフタレンスルホン酸244gを用いた以外は、実施例1と同様に3,4-エチレンジオキシチオフェンの化学酸化重合を行い、得られたポリエチレンジオキシチオフェンについて電導度を測定した。その結果を後記の表1に示す。

【0030】比較例1

合成例1で得たテトラヒドロナフタレンスルホン酸に代えて、pートルエンスルホン酸186gを用いた以外は、実施例1と同様に3,4ーエチレンジオキシチオフェンの化学酸化重合を行い、得られたポリエチレンジオキシチオフェンについて電導度を測定した。その結果を後記の表1に示す。

【0031】比較例2

合成例1で得たテトラヒドロナフタレンスルホン酸に代えて、分岐型ドデシルベンゼンスルホン酸352gを用いた以外は、実施例1と同様に3,4-エチレンジオキ20 シチオフェンの化学酸化重合を行い、得られたポリエチレンジオキシチオフェンについて電導度を測定した。その結果を後記の表1に示す。

【0032】比較例3

合成例1で得たテトラヒドロナフタレンスルホン酸に代えて、ナフタレンスルホン酸225gを用いた以外は、 実施例1と同様に3,4ーエチレンジオキシチオフェン の化学酸化重合を行い、得られたポリエチレンジオキシ チオフェンについて電導度を測定した。その結果を後記 の表1に示す。

0 【0033】比較例4

合成例1で得たテトラヒドロナフタレンスルホン酸に代えて、メチルナフタレンスルホン酸240gを用いた以外は、実施例1と同様に3,4ーエチレンジオキシチオフェンの化学酸化重合を行い、得られたポリエチレンジオキシチオフェンについて電導度を測定した。その結果を後記の表1に示す。

【0034】上記実施例1~2および比較例1~4で得たポリエチレンジオキシチオフェンの電導度を表1にそのドーパントと共に示す。

[0035]

【表1】

	電導度 (S/cm)	ドーパント
実施例1	130	テトラヒドロナフタレンスルホン酸
実施例2	1 2 0	メチルテトラヒドロナフタレンスルホン酸
比較例1	7 0	pートルエンスルホン酸
比較例2	3 0	分岐型ドデシルベンゼンスルホン酸
比較例3	70	ナフタレンスルホン酸
比較例4	8 0	メチルナフタレンスルホン酸

【0036】表1に示すように、実施例1~2のポリエ チレンジオキシチオフェンは、比較例1~4のポリエチ レンジオキシチオフェンに比べて、電導度が高く、導電 性が優れていた。

【0037】すなわち、テトラヒドロナフタレンスルホ 20 す。その高温貯蔵試験の方法は次の通りである。 ン酸をドーパントとする実施例1のポリエチレンジオキ シチオフェンおよびメチルテトラヒドロナフタレンスル ホン酸をドーパントとする実施例2のポリエチレンジオ キシチオフェンは、pートルエンスルホン酸をドーパン トとする比較例1のポリエチレンジオキシチオフェン、 分岐型ドデシルベンゼンスルホン酸をドーパントとする 比較例2のポリエチレンジオキシチオフェン、ナフタレ ンスルホン酸をドーパントとする比較例3のポリエチレ ンジオキシチオフェンおよびメチルナフタレンスルホン 酸をドーパントとする比較例4のポリエチレンジオキシ 30 チオフェンより、高い電導度を有していて、導電性が優*

*れていた。

【0038】つぎに、上記実施例1~2および比較例1 ~4のポリエチレンジオキシチオフェンについて高温貯 蔵による電導度の低下率を調べた。その結果を表2に示

【0039】高温貯蔵試験:上記実施例1~2および比 較例1~4のポリエチレンジオキシチオフェンのシート について、前記のように電導度を測定した後、各シート を130℃の高温槽中に貯蔵し、経時的にシートを取り 出して電導度を測定して、高温貯蔵による電導度の低下 率を調べた。なお、電導度の低下率は、初期電導度値

(すなわち、貯蔵前に測定した電導度値) から貯蔵後の 電導度値を引いた時の差を初期電導度値で割り、パーセ ント(%)で示した。これを式で表すと次の通りであ

[0040] - 貯蔵後の電導度値

電導度の低下率(%)= -×100

初期電導度値

[0041]

※ ※【表2】

	電導度の低下率 (%)	
	2 4時間貯蔵後	48時間貯蔵後
実施例1	1 9	3 0
実施例2	2 0	3 2
比較例1	4 0	74
比較例2	3 3	5 8
比較例3	2 7	5 0
比較例4	3 1	5 4

【0042】表2に示す結果から明らかなように、実施 例1~2のポリエチレンジオキシチオフェンは、比較例 50

1~4のポリエチレンジオキシチオフェンに比べて、2 4時間貯蔵後、48時間貯蔵後とも、電導度の低下が少 q

なく、耐熱性が優れていた。

【0043】すなわち、テトラヒドロナフタレンスルホン酸をドーパントとする実施例1のポリエチレンジオキシチオフェンおよびメチルテトラヒドロナフタレンスルホン酸をドーパントとする実施例2のポリエチレンジオキシチオフェンは、pートルエンスルホン酸をドーパントとする比較例1のポリエチレンジオキシチオフェン、分岐型ドデシルベンゼンスルホン酸をドーパントとする比較例2のポリエチレンジオキシチオフェン、ナフタレンスルホン酸をドーパントとする比較例3のポリエチレンジオキシチオフェンおよびメチルナフタレンスルホン酸をドーパントとする比較例4のポリエチレンジオキシチオフェンに比べて、高温貯蔵による電導度の低下が少なく、耐熱性が優れていた。

【0044】実施例3

この実施例3では、電解酸化重合により導電性高分子を合成し、その評価をする。まず、電解酸化重合の陽極として用いる導電性高分子でコートしたセラミックプレートの作製を行った。すなわち、酸化剤としてpートルエンスルホン酸第二鉄塩を水溶液状で用い、実施例1と同20様の操作で化学酸化重合を行うことにより、ポリエチレンジオキシチオフェンでコートしたセラミックプレートを作製した。得られたセラミックプレート(すなわち、ポリエチレンジオキシチオフェンでコートしたセラミックプレート)を陽極とし、ステンレス鋼(SUS304)を陰極として以下に示すようにピロールの電解酸化重合を行った。

【0045】前記合成例3で得たブチルテトラヒドロナフタレンスルホン酸ナトリウム塩をあらかじめ濃度が0.04mol/1になるように純水で濃度調整した溶 30液に、ピロールを濃度が0.04mol/1になるよう*

*に添加した。そして、上記に示した電極を用い、1 mA/c mの定電流を70分かけて電解酸化重合することにより、ブチルテトラヒドロナフタレンスルホン酸を取り込んだポリピロールを合成した。得られたポリピロールをエタノールにより充分に洗浄し、150℃で1時間乾燥した後、4探針方式の電導度測定器(三菱化学社製のMCP-T600)により表面抵抗を測定した。その結果を後記の表3に示す。

10

【0046】比較例5

合成例3で得たブチルテトラヒドロナフタレンスルホン酸ナトリウム塩に代えて、pートルエンスルホン酸ナトリウム塩を用いた以外は、実施例3と同様にピロールを電解酸化重合し、得られたポリピロールの表面抵抗を測定した。その結果を後記の表3に示す。

【0047】比較例6

合成例3で得たブチルテトラヒドロナフタレンスルホン酸ナトリウム塩に代えて、分岐型ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム塩を用いた以外は、実施例3と同様にピロールを電解酸化重合し、得られたポリピロールの表面抵抗を測定した。その結果を後記の表3に示す。

【0048】比較例7

合成例3で得たブチルテトラヒドロナフタレンスルホン酸ナトリウム塩に代えて、ブチルナフタレンスルホン酸ナトリウム塩を用いた以外は、実施例3と同様にピロールを電解酸化重合し、得られたポリピロールの表面抵抗を測定した。その結果を後記の表3に示す。

【0049】上記実施例3および比較例5~7で得たポリピロールの表面抵抗の測定結果を表3にそのドーパントと共に示す。

[0050]

【表3】

	表面抵抗 (Ω)	ドーパント
実施例3	5. 0	プチルテトラヒドロナフタレンスルホン酸
比較例 5	7. 0	pートルエンスルホン酸
比較例 6	6. 5	分岐型ドデシルベンゼンスルホン酸
比較例7	11.5	プチルナフタレンスルホン酸

【0051】表3に示すように、実施例3のポリピロールは、比較例5~7のポリピロールに比べて、表面抵抗が小さく、高い電導度を有することが明らかであった。すなわち、ブチルテトラヒドロナフタレンスルホン酸をドーパントとする実施例3のポリピロールは、pートルエンスルホン酸をドーパントとする比較例5のポリピロール、分岐型ドデシルベンゼンスルホン酸をドーパントとする比較例6のポリピロールおよびブチルナフタレン50

スルホン酸をドーパントとする比較例7のポリピロール に比べて、表面抵抗が小さく、導電性が優れていた。特 に実施例3のポリピロールは、ブチルナフタレンスルホ ン酸をドーパントとする比較例7のポリピロールに比べ て、表面抵抗が小さく、導電性が優れていた。

【0052】つぎに、上記実施例3および比較例5~7のポリピロールについて、上記のように表面抵抗を測定した後、前記実施例1のポリエチレンジオキシチオフェ

11

* [0053]

ンなどと同様に高温貯蔵試験を行い、高温貯蔵による表 面抵抗の増加を調べた。その結果を表4に示す。 【表4】

	表面抵抗 (Ω)	
	2 4時間貯蔵後	48時間貯蔵後
実施例3	1 3	2 5
比較例 5	5 0	102
比較例6	3 0	5 8
比較例7	1 4	2 6

【0054】表4に示すように、実施例3のポリピロー ルは、比較例5~6のポリピロールに比べて、24時間 貯蔵後、48時間貯蔵後とも、表面抵抗が小さく、耐熱 性が優れていた。

【0055】すなわち、p-トルエンスルホン酸をドー パントとする比較例5のポリピロールと分岐型ドデシル ベンゼンスルホン酸をドーパントとする比較例6のポリ ピロールは、前記表3に示すように、貯蔵前には、ブチ ルテトラヒドロナフタレンスルホン酸をドーパントとす る実施例3のポリピロールに比べて、それほど表面抵抗 が大きくなかったけれど、高温で貯蔵した場合には、実 施例3のポリピロールに比べて、表面抵抗が大きく増加 して、耐熱性が劣っていた。また、ブチルナフタレンス ルホン酸をドーパントとする比較例7のポリピロール は、高温貯蔵による表面抵抗の増加はそれほど大きくな かったが、前記表3に示したように、貯蔵前の表面抵抗 が実施例3のポリピロールに比べて大きく、実施例3の 30 ポリピロールのように、優れた導電性および優れた耐熱 性を兼備することができなかった。 ×

※【0056】実施例4~5および比較例8~11

アルミニウム箔の表面をエッチング処理した後、化成処 理を行い、誘電体皮膜を形成した陽極箔と陰極箔として のアルミニウム箔とをセパレータを介して巻回してコン デンサ素子を作製した。そして、このコンデンサ素子の セパレータ部分に3,4-エチレンジオキシチオフェン を含浸させ、さらに実施例1~2および比較例1~4の 過程で得られたそれぞれのスルホン酸第二鉄塩をそれぞ れ別々に含浸させ、60℃で2時間加熱することにより ポリエチレンジオキシチオフェンからなる固体電解質層 を形成した。そして、それを外装材で外装して、固体電 解コンデンサを得た。

【0057】このようにして作製した実施例4~5およ び比較例8~11の固体電解コンデンサの等価直列抵抗 (ESR) の測定した。その結果をドーパントの種類と 共に表5に示す。

[0058]

【表5】

	ESR	導電性高分子のドーパント
実施例 4	30mQ以下	テトラヒドロナフタレンスルホン酸
実施例 5	30mQ以下	メチルテトラヒドロナフタレンスルホン酸
比較例8	>30mQ	pートルエンスルホン酸
比較例 9	>30mQ	分岐型ドデシルペンゼンスルホン酸
比較例10	>30mΩ	ナフタレンスルホン酸
比較例11	>3 0 mΩ	メチルナフタレンスルホン酸

【0059】表5に示すように、実施例4~5の固体電 解コンデンサは、比較例8~11の固体電解コンデンサ に比べて、ESR値が小さかった。

【0060】すなわち、テトラヒドロナフタレンスルホ ン酸をドーパントとする導電性高分子を固体電解質とし 50 て用いた実施例4の固体電解コンデンサおよびメチルテ

トラヒドロナフタレンスルホン酸をドーパントとする導電性高分子を固体電解質として用いた実施例5の固体電解コンデンサは、pートルエンスルホン酸をドーパントとする導電性高分子を固体電解質として用いた比較例8の固体電解コンデンサ、分岐型ドデシルベンゼンスルホン酸をドーパントとする導電性高分子を固体電解質として用いた比較例9の固体電解コンデンサ、ナフタレンスルホン酸をドーパントとする導電性高分子を固体電解質として用いた比較例10の固体電解コンデンサおよびメチルナフタレンスルホン酸をドーパントとする導電性高*10

13

*分子を固体電解質として用いた比較例11の固体電解コンデンサに比べて、ESRが小さく、高温・高湿条件下における特性の信頼性が高かった。

[0061]

【発明の効果】以上説明したように、本発明では、導電性が優れ、かつ耐熱性が優れた導電性高分子を提供することができ、また、その導電性高分子を固体電解質として用いて高温・高湿条件下における信頼性の高い固体電解コンデンサを提供することができた。

フロントページの続き

(72)発明者 都築 隆生

大阪市大正区船町1丁目3番47号 テイカ株式会社内

F ターム(参考) 4J032 BA13 BD02 CG01 4J043 QB02 RA08 SA05 UA121 YB05 YB38 ZA44 ZB49